

ЧЕТЫРЕХПОЗИЦИОННАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ИСПАРЕНИЯ СО ШЛЮЗОВОЙ НАГРУЗКОЙ

ЭЛИМ ТМ 5

Назначение: Нанесение металлических, диэлектрических или резистивных тонких пленок на подложки (пластины) методом магнетронного распыления и электронно-лучевого испарения.



Особенности:

- Групповая обработка подложек в одном технологическом цикле: $\varnothing 76\text{мм}$ – 15 шт.; $\varnothing 100\text{мм}$ – 9 шт.; $\varnothing 150\text{мм}$ – 3 шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек (Позиция 1);
- Система переноса подложек из шлюзовой камеры в две рабочие позиции (2,3) транспортной каруселью;
- Система магнетронного распыления (Позиция 4);
- Четырехтигельный электронно-лучевой испаритель (Позиция 3);
- Предварительный нагрев подложек и их очистка с помощью источника ионов (Позиция 2);
- Безмасляная система откачки;
- Мощность потребления не более 20 кВт.

